

# Comment créer son idHAL ?

<https://doc.archives-ouvertes.fr/compte-et-profil/>

« J'ai déjà un compte HAL ! Pourquoi ai-je besoin d'un IdHAL ? »

Le compte HAL sert à se connecter sur la plateforme et à faire des dépôts de documents à l'aide d'un login et d'un mot de passe.

L'IdHAL est un identifiant auteur unique, différent du login. Il permet de rattacher une production à un seul profil auteur.

Se connecter à son compte HAL sur <https://hal.archives-ouvertes.fr/> ou faire une demande de compte sur la [page de connexion](#).

Lors d'une première connexion, on vous demande de paramétrer vos préférences de dépôt. Si vos affiliations automatiques sont à jour, passez à l'étape 3 création de l'idHAL.

## 1. Préférences de dépôt

Dans l'onglet Mon espace/mon profil, sélectionner les préférences de dépôt et faire vos choix.

HAL

Informations de mon profil HAL

Préférences de dépôt

Préférences de réception de courriel

The screenshot shows the 'Mes préférences de dépôt' (My deposit preferences) page on the HAL website. The page is titled 'Modification de votre compte' and includes a navigation menu with 'Accueil', 'Dépôt', 'Consultation', 'Recherche', 'Documentation', and 'Mon espace'. The main content area is titled 'Mes préférences de dépôt' and contains the following sections:

- Formulaire de dépôt:** A section with the text 'En vue simple n'apparaissent que les métadonnées obligatoires. Vous pouvez naviguer entre les 2 vues lors de votre dépôt.' It has two radio buttons: 'Vue simple' (selected) and 'Vue détaillée'.
- Domaines:** A dropdown menu currently showing 'Sciences de l'ingénieur (physics)'. Below it is a button 'Afficher la liste des domaines'.
- M'ajouter comme auteur:** A section with the text 'Doit-on vous associer automatiquement comme auteur de vos nouveaux dépôts ?' and two radio buttons: 'Oui' (selected) and 'Non'.
- Affiliation(s):** A text input field containing 'IEMN' and a dropdown menu showing a list of affiliations: 'Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520', 'ENR (2023 → ...)', 'Université de Lille', 'UMF Université Polytechnique Hauts-de-France', 'Ecole Centrale de Lille', 'CNRS Centre National de la Recherche Scientifique', and 'JUNIA JUNIA'.
- Affilier les auteurs automatiquement:** A section with a text input field containing 'CMNF' and a dropdown menu showing a list of affiliations: 'Centrale de Micro Nano Fabrication - IEMN', 'CMNF - IEMN (2023 → ...)', and 'IEMN Institut d'Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520'.

Annotations with red arrows point to specific elements:

- A box on the left says: 'choisir «oui» pour que vos affiliations soient automatiquement renseignées lors des dépôts'. An arrow points to the 'Oui' radio button in the 'M'ajouter comme auteur' section.
- A box on the right says: 'choisir une vue détaillée permet d'ajouter un projet ANR / européen, un résumé, un id ArXiv,...'. An arrow points to the 'Vue détaillée' radio button.
- A box on the right says: 'Sciences pour l'Ingénieur sera rentré par défaut lors des dépôts'. An arrow points to the 'Sciences de l'ingénieur (physics)' dropdown menu.
- A box on the left says: 'Sélectionnez l'affiliation IEMN (id : 1066983) et groupe. Ex : CMNF - IEMN'. An arrow points to the 'IEMN' text input field in the 'Affiliation(s)' section.

Affiliation(s) Veillez saisir le nom ou l'acronyme de votre laboratoire et le sélectionner dans la liste

Centrale de Micro Nano Fabrication - IEMN (2021 - ...) (1067490) X  
 Institut d'Electronique, de Microelectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - UMR 8520 IEMN (2021 - ...) (1069883) X

Affilier les auteurs automatiquement Il est recommandé de vérifier les affiliations automatiques des auteurs déduites à partir du document déposé.

Oui  Non

**Nouveau 2020** : on peut activer l'affiliation automatique co-auteurs. Toujours vérifier les propositions faites par HAL

Enregistrer les modifications

Enregistrer vos préférences de dépôt.

## 2. Préférences de réception de courriel

**HAL**

Informations de mon profil HAL

Préférences de dépôt

Préférences de réception de courriel

Recevoir la confirmation de vos dépôts  Oui

Recevoir les notifications lorsque vous êtes identifié comme co-auteur  Oui

Modifier mes préférences de courriel

Pour être automatiquement averti par courriel dès qu'un dépôt est mis en ligne, cochez la/les case(s)

Recevoir la confirmation de vos dépôts

Recevoir les notifications lorsque vous êtes identifié comme co-auteur

**Bien activer la case « recevoir les notifications lorsque vous êtes identifié comme auteur »** : vous êtes ainsi averti par un mail vous permettant de valider que vous en êtes bien co-auteur : ce dépôt est alors présent dans votre espace et vous pourrez le modifier/le compléter.

## 3. Création de l'idHAL :

Dans l'onglet Mon espace/mon profil/informations sur mon profil HAL

CCSD HAL - Episciences.org - Scanzoncert.org - Support

Mon espace Mon profil

**CCSD**

Informations de mon profil CCSD

Identifiant 977912

Login salha ouendi

Nom de famille Ouendi

Prénom Salha

Courriel salha.ouendi@univ-lyon.fr

Mon espace FTP  Espace FTP

Modifier mon profil

**HAL**

Informations de mon profil HAL

Votre nom dans HAL: Salha Ouendi

Mon idhal:

Langue: français

Modifier mon profil

Préférences de dépôt

Préférences de réception de courriel

Cliquer sur créer mon idHAL

Choisir la chaîne de caractères souhaitée pour l'idHAL (en général, HAL propose prénom-nom). Attention : une fois enregistré, l'idHAL ne peut plus être modifié. Vous pouvez indiquer si vous le souhaitez d'autres identifiants chercheur (arXiv, idRef,...)

CCSD HAL - Episciences.org - Sciencesconf.org Support fr Saliha Ouendi

Accueil Dépôt Consultation Recherche Documentation Mon espace

Regroupez vos formes auteurs et créez votre IdHAL

### Identifiants

\* Champs requis

**IdHAL** Attention, cet identifiant ne pourra plus être modifié par la suite  
 **idHAL suggéré**

**Autres identifiants chercheur** Alignez votre IdHAL avec vos autres identifiants chercheurs  
 **arXiv,...**

**Urls de réseaux sociaux** Ajoutez vos liens vers les réseaux sociaux

Puis, rattacher des formes auteurs présentes sur HAL à votre idHAL :

Indiquer une première variante auteur (ex : nom de famille) et cliquer sur rechercher :

### Formes auteurs associées à votre IdHAL

Ajouter des formes auteurs Saliha Ouendi   **rechercher formes auteurs**

Vérifier la pertinence des documents en cliquant sur consulter les documents associés à cette forme auteur, icone en haut à droite.

### Formes auteurs associées à votre IdHAL

Ajouter des formes auteurs Saliha Ouendi

**Résultats**

Authorid	Nom prénom	Domaine e-mail	Établissement employeur	
11492246	Ouendi Saliha			<input type="button" value="Consulter les documents associés à cette forme auteur"/>

Tous / Aucun

Saliha Ouendi, Cassandra Arico, Florent Blanchard, Jean-Louis Codron, Xavier Wallart, et al.. Synthesis of T-Nb2O5 thin-films deposited by Atomic Layer Deposition for miniaturized electrochemical energy storage devices. *Energy Storage Materials*, Elsevier, 2019, 16, pp.581-588. (10.1016/j.ensm.2018.08.022). (hal-02135683)

Saliha Ouendi, Kevin Robert, Didier Stiévenard, Thierry Brousse, Pascal Roussel, et al.. Sputtered tungsten nitride films as pseudocapacitive electrode for on chip micro-supercapacitors. *Energy Storage Materials*, Elsevier, 2019, 20, pp.243-252. (10.1016/j.ensm.2019.04.006). (hal-02187904)

Cassandra Arico, Kevin Robert, Kevin Brousse, Saliha Ouendi, Camille Douard, et al.. Thin film electrodes for fast electrochemical microdevices based on redox or intercalation pseudocapacitance. *232th Electrochemical Society Meeting (ECS232)*, Oct 2017, Washington, United States. (hal-02330660)

**Décocher les références qui ne sont pas les vôtres**

**Cliquer pour consulter les docs**

Cliquer sur Ajouter cette forme à mon idHAL, icone en haut à droite.

Ajouter des formes auteurs Saliha Ouendi

**Résultats**

Authorid	Nom prénom	Domaine e-mail	Établissement employeur	
11492246	Ouendi Saliha			<input type="button" value="Ajouter cette forme à mon idHAL"/>

Saliha Ouendi, Cassandra Arico, Florent Blanchard, Jean-Louis Codron, Xavier Wallart, et al.. Synthesis of T-Nb2O5 thin-films deposited by Atomic Layer Deposition for miniaturized electrochemical energy storage devices. *Energy Storage Materials*, Elsevier, 2019, 16, pp.581-588. (10.1016/j.ensm.2018.08.022). (hal-02135683)

Saliha Ouendi, Kevin Robert, Didier Stiévenard, Thierry Brousse, Pascal Roussel, et al.. Sputtered tungsten nitride films as pseudocapacitive electrode for on chip micro-supercapacitors. *Energy Storage Materials*, Elsevier, 2019, 20, pp.243-252. (10.1016/j.ensm.2019.04.006). (hal-02187904)

**Cliquer Ajouter à idHAL**

La première forme auteur (ici le nom complet) est bien rattachée à l'idHAL :

### Formes auteurs associées à votre IdHAL

Défaut	Authorid	Nom prénom	E-mail	Établissement employeur	Actions
<input type="radio"/>	11492246	Ouendi Saliha			

Ajouter des formes auteurs

Résultats ×

Authorid	Nom prénom	Domaine e-mail	Établissement employeur	Actions
11203320	Ouendi S			

Tous / Aucun

E Elmi, R Cristini-Robbe, M. Chen, B Wei, R. Bernard, et al... Local Schottky contacts of embedded Ag nanoparticles in Al 2 O 3 /SiN x :H stacks on Si: a design to enhance field effect passivation of Si junctions. *Nanotechnology*, Institute of Physics, 2018, 29 (28), (10.1088/1361-6528/aac032). (hal-01794379)

E Elmi, R Cristini-Robbe, M. Chen, B Wei, R. Bernard, et al... Local Schottky contacts of embedded Ag nanoparticles in Al 2 O 3 /SiN x :H stacks on Si: a design to enhance field effect passivation of Si junctions. *Nanotechnology*, Institute of Physics, 2018, 29 (28), (10.1088/1361-6528/aac032). (hal-01794058)

Reproduire l'opération avec différentes graphies, pour ratisser large on peut taper uniquement le nom de famille et faire le tri, ou essayer toutes les variantes possibles de son nom (initiale, initiale avec point, noms composés, nom marital, éventuelles variantes d'orthographe erronées utilisées par les co-auteurs, etc...)

Enregistrer lorsqu'on s'est assuré d'avoir balayé toutes les formes auteur. Choisir la forme par défaut à afficher.

### Formes auteurs associées à votre IdHAL

Défaut	Authorid	Nom prénom	E-mail	Établissement employeur	Actions
<input checked="" type="radio"/>	11492246	Ouendi Saliha			
<input type="radio"/>	11203320	Ouendi S			

Ajouter des formes auteurs

Résultats ×

Authorid	Nom prénom	Domaine e-mail	Établissement employeur	Action
11168047	Ouendi M.	Autre auteur : ne pas associer		
11942135	Ouendi M			

Une fois validé, la possibilité de synchroniser avec votre ORCID apparait à l'écran. Prévoir vos identifiants de connexion à orcid.org pour cela.

CCSD HAL Episciences.org Sciencesconf.org Support fr Salha Ouendi

Regroupez vos formes auteurs et créez votre IdHAL.

Identifiants

IdHAL

Identifiant ORCID

Autres identifiants chercheur

Urns de réseaux sociaux

Synchroniser avec votre N° ORCID

